CR-2000硬铬电镀工艺

产品名称	CR-2000硬铬电镀工艺
公司名称	南京安瑞泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安瑞泰 型号:桶
公司地址	南京市江宁区淳化南京安瑞泰科技有限公司
联系电话	02552295638 15852922861

产品详情

CR-2000硬铬电镀工艺

CR-2000硬铬电镀工艺是高新技术和创造思维的结晶，完全不同与常规镀铬和普通混合型催化剂镀铬工艺，其工艺操作简单，补给水单一添加，镀液维护方便。

一、工艺特点： 1.阴极电流效率高，可达23-25% 2.沉积速度快，是一般普通电镀铬的2-3倍
3.无阴极低电流区腐蚀 4.镀层平滑，结晶细致光亮 5.高镀层硬度，可达HV900-1150
6.微裂纹可达400-600条/厘米 7.镀层厚度均匀，无高电流区沉积过厚
8.可使用高电流密度，可达90安培/平方分米 9.镀液维护简单，操作容易
10.无阳极腐蚀，不需采用特殊阳极 11.无固体添加之铬尘和溅水现象

二、镀液配方和操作工艺：

成分和物理参数	一般零件		活塞环	
	范围	标准	范围	标准
铬酐(克/升)	210-250	230	165-190	180

硫酸(克/升)	2.4-3.5	2.7	1.8-2.1	2.0
温度(°C)	55-60	57	55-60	57
阴极电流密度(安培/平方分米)	30-75	60	30-75	60
阳级电流密度(安培/平方分米)	15-35	30	15-35	30

三、镀液配制：

镀件	铬酐浓度	100升镀液
一般零件	210-250克/升	2升CR-2000
活塞环	165-190克/升	1.45升CR-2000

1.清洗槽子 2.注入一半体积去离子水 3.加入所需量的铬酐 4.添加所需量的CR-2000

5.加入去离子水、调节至规定液面 6.加热至55-60°C 7.分析硫酸浓度，调整至规定工艺范围 8.电解4小时 9.加入适宜的铬雾抑制剂 10.试镀 **四、沉积速度：**

阴极电流密度(安培/平方分米)	沉积速度(微米/小时)
30	20-30
45	40-50
60	50-70
75	70-90

五、设备： 镀槽：铁槽内衬软PVC或其它认可材料。 阳极：含锡7%铅锡阳极或其它认可材料。
整流器：输出电压可达9-16伏较适宜，输出电流波纹率最好在5%以下。
温度控制：采用热交换器或冷却管，建议采用钛管或金属披覆聚四氟乙烯。 **六、转缸及前处理**：
传统的硬铬液转为CR-2000工艺简单，将镀液送交本厂化验。 确认无机杂质小于7.5克/升，同时不含氟化物即可，CR-2000工艺的前处理同一般传统镀铬相同无需特殊处理。
七、槽液维护： CR-2000用于槽液之补充添加，按每千安培小时补充4-6毫升。